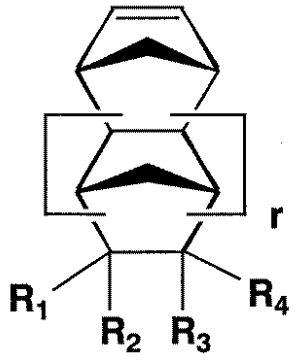
【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成17年12月22日(2005.12.22)

【公表番号】特表2004-512396(P2004-512396A)
【公表日】平成16年4月22日(2004.4.22)
【年通号数】公開・登録公報2004-016
【出願番号】特願2002-536611(P2002-536611)
【国際特許分類第７版】
　Ｃ０８Ｆ 232/00
　Ｇ０３Ｆ　 7/039
　Ｈ０１Ｌ　21/027
【ＦＩ】
　Ｃ０８Ｆ 232/00
　Ｇ０３Ｆ　 7/039　 ６０１
　Ｈ０１Ｌ　21/30　 ５０２Ｒ

【手続補正書】
【提出日】平成16年10月8日(2004.10.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
　【請求項１】　フォトレジスト組成物であって、該組成物は、
（ａ）フッ素含有ポリマーであって、少なくとも
　（Ａ）エチレン、α－オレフィン、１，１’－二置換オレフィン、ビニルアルコール、ビニルエーテルおよび１，３－ジエンからなる群から選択されるスペーサー基と、
　（Ｂ）以下の構造：
【化１】



〔式中、
　R_1、R_2、R_3およびR_4は、それぞれ独立して、水素、ハロゲン原子、１～１０の炭素原子を含有する炭化水素基、置換炭化水素基、アルコキシ基、カルボン酸、カルボン酸エステル、または以下の構造：
　$-C(R_f)(R_f')OR_b$
（式中、R_fおよびR_f'は、１～１０の炭素原子を有する同一または異なるフルオロアルキル基であるか、あるいは一緒になって$(CF_2)_n$であり、ｎは２～１０であり、R_bは水素、または酸もしくは塩基に不安定な保護基である）
を含有する官能基であり、

ｒは、０～４である〕
を有するモノマーから誘導される繰返し単位と
から調製され、
前記繰返し単位（Ｂ）の少なくとも１つは、R_1、R_2、R_3およびR_4の少なくとも１つが前記構造Ｃ（R_f）（R_f'）OR_bを含有する構造を有するフッ素含有ポリマー、および
（ｂ）少なくとも１つの光活性成分
を含み、
前記フッ素含有ポリマーが１５７ｎｍの波長において４．０μm^{-1}未満の吸収係数を有することを特徴とするフォトレジスト組成物。

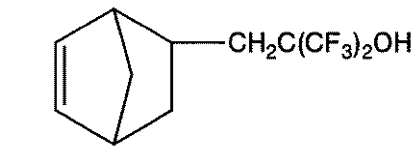
【請求項２】　R_fおよびR_f'が独立して、１～５の炭素原子を有するペルフルオロアルキル基であることを特徴とする請求項１に記載のフォトレジスト組成物。

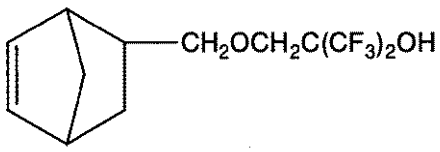
【請求項３】　R_fおよびR_f'がトリフルオロメチルであることを特徴とする請求項２に記載のフォトレジスト組成物。

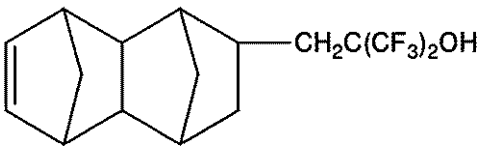
【請求項４】　前記スペーサー基が、エチレン、プロピレン、イソブチレン、エチルビニルエーテルおよびブタジエンからなる群から選択されることを特徴とする請求項１に記載のフォトレジスト組成物。

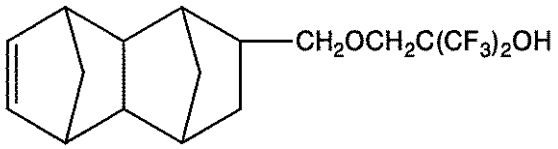
【請求項５】　前記フルオロアルコール官能基含有モノマーが、

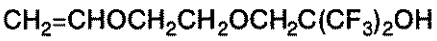
【化２】

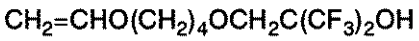


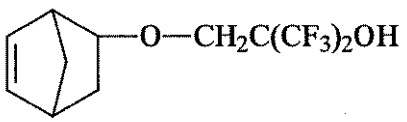


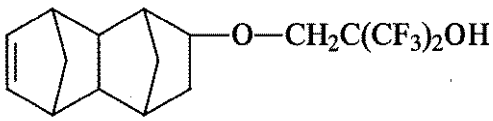












からなる群から選択されることを特徴とする請求項１に記載のフォトレジスト組成物。